

# 中国真空学会 2016 学术年会

## 征文通知（第二轮）

会议官方网站：[www.cvsnet.org.cn](http://www.cvsnet.org.cn)

由中国真空学会主办、云南师范大学与北京大学承办的中国真空学会 2016 学术年会将于 2016 年 8 月 12-14 日在云南省昆明市举办。热切希望全体学会会员、理事及科研院所、企业同仁等踊跃投递论文。

大会将设一个主会场和六个分会场。（六个分会场分别是：1、真空科技与工程；2、表面科学与应用；3、薄膜科学与技术；4、纳米科学与技术；5、电子材料与器件、等离子体技术；6、显示技术等）。学术交流将采取多种形式：大会特邀报告，分会邀请报告，分会口头报告，张贴报告，会间将评选“最佳张贴报告奖”。

征文范围：

1. 真空科技与工程（真空科学与技术、真空工程、真空冶金与表面工程、真空获得与测量、质谱分析与检漏）
2. 表面科学与应用（表面科学与技术、应用表面科学与技术）
3. 薄膜科学与技术（薄膜生长机理、制备技术和应用）
4. 纳米科学与技术（纳米科学与技术、纳米生物与生物界面）
5. 电子材料与器件、等离子体技术（电子材料与器件、真空微电子学、等离子体物理与技术）
6. 显示技术（显示技术）

一、征文要求

1、本次学术会议欢迎与会者踊跃投稿，只需提交论文摘要（中、英文均可），网站上有摘要模版供下载编辑。

2、本次会议的摘要投稿请通过会议官方网站进行，

网址：<http://www.cvsnet.org.cn>，网站投稿开通时间为 2016 年 3 月 1 日，参会者需要先在网站上注册，然后根据摘要模板编辑摘要格式，并依照网站上说明提交摘要。（详情见会议网站上的论文投稿流程说明）

3、大会将出版论文摘要集，为统一摘要格式，请务必采用网站提供的摘要模板编辑。

4、网上投稿时请务必填写报告人、所属的分会编号（大会邀请报告除外）、以及报告类型等信息。

5、摘要是否被录用、以及报告的类型将在 2016 年 7 月份另行通知作者。

6、对于口头报告，会议备有多媒体设备，请自备 U 盘。

张贴报告请自行打印，尺寸：90cm× 120cm。

## 二、截稿日期

1、摘要截稿日期：**2016 年 6 月 20 日前**。

2、摘要投稿过程中，如果遇到学术问题，请与所属分会的负责人联系。

3、摘要投稿过程中，如果遇到技术问题，请与中国真空网负责人联系。

中国真空网：马雯卿 电话：021-62121126 转 814

会务组：中国真空学会办公室

地址：北京市朝阳区建国路 93 号万达广场 9 号楼 612 室

邮编：100022

电话：010-58208908/58208985 传真：58207735

QQ1：2317369989

QQ2：1563526075

E-mail: cvs@chinesevacuum.com

zgzkxh@chinesevacuum.com

